

【技術資料】 脆弱試料の断面作製法 (断面イオンミリング(クロスセクションポリッシャ:CP))

概要

クロスセクションポリッシャ(CP)は、イオンミリングにより断面試料を作製する装置です。イオンビームで試料を削ることによって清浄断面が得られ、多孔質試料や脆弱で剥離しやすい試料、複合材料などの断面試料作製が可能です。



分析事例の紹介

パウダーファンデーションの断面を研磨とCPでそれぞれ作製し、FE-SEM 観察により比較しました。下図のように、研磨では加工により崩れている構造が、CP 加工断面では明瞭に観察されています。

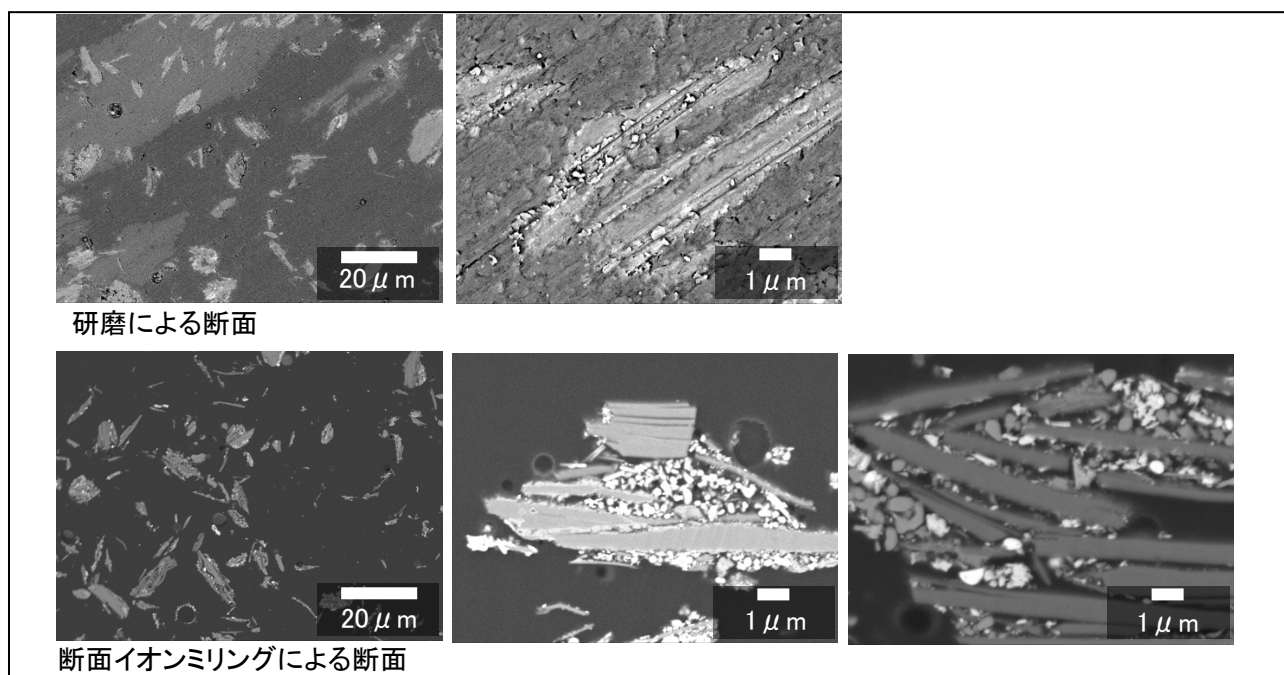


図 FE-SEM による断面観察

材料キーワード: パウダーファンデーション、化粧品

適用分野

医薬品、化粧品、農薬